

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和3年4月22日(2021.4.22)

【公表番号】特表2020-509925(P2020-509925A)

【公表日】令和2年4月2日(2020.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2020-013

【出願番号】特願2019-544884(P2019-544884)

【国際特許分類】

B 0 1 J	23/89	(2006.01)
B 0 1 J	35/10	(2006.01)
B 0 1 J	37/08	(2006.01)
B 0 1 J	37/02	(2006.01)
C 0 7 C	31/04	(2006.01)
C 0 7 C	31/08	(2006.01)
C 0 7 C	29/154	(2006.01)
C 0 7 B	61/00	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	23/89	M
B 0 1 J	35/10	3 0 1 G
B 0 1 J	37/08	
B 0 1 J	37/02	1 0 1 A
C 0 7 C	31/04	
C 0 7 C	31/08	
C 0 7 C	29/154	
C 0 7 B	61/00	3 0 0

【手続補正書】

【提出日】令和3年3月8日(2021.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

合成ガスの転化のための触媒であって、前記触媒は第1触媒要素及び第2触媒要素を有し、

前記第1触媒要素は、第1多孔質酸化物担体上に担持された、R h、Mn、アルカリ金属M、及びFeを有し、且つ、前記第2触媒要素は、第2多孔質酸化物担体上に担持された、Cu、及びCu以外の遷移金属を有する、触媒。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項18

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項18】

(i)の前に(i)で準備された前記触媒が還元され、前記触媒の還元は、好ましくは、水素を有するガス流と該触媒との接触を含み、該ガス流の好ましくは少なくとも95容積%、好ましくは少なくとも98容積%、より好ましくは少なくとも99容積%が、水素からなり、水素を有する該ガス流は、好ましくは250～350までの範囲内、よ

り好ましくは275～325までの範囲内のガス流温度で前記触媒と接触され、且つ、水素を有する該ガス流は、好ましくは10～100bar（abs）までの範囲内、好ましくは20～80bar（abs）までの範囲内のガス流圧力で前記触媒と接触される、請求項17に記載の方法。